

# Hafnia Ferroelectric Device

전상훈 / KAIST

CMOS 게이트 절연막으로 잘 알려진  $\text{HfO}_2$  소재에서 강유전체 특성이 발견됨에 따라서, 이를 활용한 다양한 반도체 소자와 이의 응용에 대한 많은 관심을 받고 있습니다. 본 세미나에서는  $\text{HfO}_2$  강유전체를 활용한 로직, 메모리, 비휘발성 로직, 디스플레이, 전자피부 분야에 활용될 수 있는 가능성과 실현 방법 및 도전 과제에 대해서 논의합니다.